装置担当者表 Equipment responsible persons list					Last update 2025/12/10	
メインクリーンルーム Main clean room (1F clean room)					.	
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
熱酸化炉(Thermal oxidation furnace)					T.Tanaka Lab	6909
CCP-RIE#3					T.Tanaka Lab	6909
ICP-RIE#1	橘田(Kitta, T.Tanaka Lab)	6909	小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
ICP-RIE#2	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256	【研究室内担当】 田中(秀)：Pablo (D2) 小野：Han (R), Yamanami (M1) 金森：猪股	6937 5810 4894	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894
CCP-RIE#1	劉 (Liu, fukushima Lab) 岩沼（iwanuma, T.Tanaka Lab)	5248 6909	Vergara(S.Tanaka)	6937	T.Tanaka Lab	6909
CCP-RIE#2(Cl2 RIE)	Toan(Ono Lab)	5810			戸田(Toda, Ono Lab)	5810
FAB	池田(Ikeda, Kanamori Lab)	4894			Kanamori Lab	4894
イオン注入装置 (Ion implantation)	Vergara(S.Tanaka)	6937				
プラズマTEOS CVD (Plasma-enhanced TEOS CVD)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256	Vergara(S.Tanaka)	6937	塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
EVG wafer bonder	Wang T. (S.Tanaka)				Vergara(S.Tanaka)	6937
プラズマ/オゾンTEOS CVD (Plasma/ozone TEOS CVD)	小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	T.Tanaka Lab	6909
プラズマSiN CVD (Plasma-enhanced SiN CVD)	小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909				
二周波励起RIE (Dual frequency RIE)	小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
エリプソメーター (Ellipsometer)	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	坂本（Sakamoto, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
接触式段差計(Stylus profilometer)	佐藤（Sato, Fukushima Lab)	5248	佐々木（Sasaki, Fukushima lab)	5248	T.Tanaka Lab	6909
UV照射器 (UV exposure)	橘田（Kitta, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
SiNエッチャー (SiN etcher)	小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab)	6909			T.Tanaka Lab	6909
SiCN Cat-CVD	戸田 (Toda, Ono Lab)	5810			Ono Lab	5810
イオンビームミリング装置 (Ion beam milling)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	Pablo (S.Tanaka Lab)	6937	Vergara(S.Tanaka Lab)	6937
ICP-RIE#3(Pegasus Advanced)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256	【研究室内担当】 田中(秀)：Wang X. 小野： Lei 金森：千葉	6937 5810 4894	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894
超臨界CO2乾燥装置 (Supercritical CO2 drier)	堀口 (Horiguchi, Ono Lab)	5810			戸田 (Toda Ono Lab)	5810
4探針測定器(Four-probe resistivity measurement)	岩沼(Iwanuma, T.Tanaka)	6909	橘田（Kitta, T.Tanaka Lab)	6909	T.Tanaka Lab	6909
汎用アッシャー(Asher for general use)	渡辺(Watanebe, MNC)	6256				
Bonder (EVG540)	森 （Mori, Fukushima Lab)	4119	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	Fukushima Lab	5248
Bond Alignment System(EVG)	森 （Mori, Fukushima Lab)	4119			Fukushima Lab	5248
Flip chip bonder(TORAY)	玉手 (Tamate, Fukushima Lab)	022-398-6264	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	Fukushima Lab	5248
172nmｴｷｼﾏ照射装置(Excimer exposure)	市坪(Ichitsubo, Fukushima Lab)	022-398-6264	佐々木（Sasaki, Fukushima lab)	5248	Fukushima Lab	5248
Plasma cleaner (samco)	森 （Mori, Fukushima Lab)	4119	佐藤 （Sato, Fukushima Lab) 張 （Zhang, T.Tanaka Lab)	5248 6909	Fukushima Lab	5248
Plasma cleaner (ONTOS)	ムルゲサン (Murugesan, Fukushima Lab)	4119	佐々木 （Sasaki, Fukushima Lab) 張 （Zhang, T.Tanaka Lab)	5248 6909	Fukushima Lab	5248
Lift-off EQP(ASAP)	金野 (Konno, Fukushima Lab)	022-398-6264	遠藤 (Endo, Fukushima Lab)	022-398-6264	Fukushima Lab	5248
金属蒸着室 Metal Deposition room (1F clean room)						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
RF magnetron sputter (ANELVA)	増渕(Masubuchi, Tohmyoh Lab)	6898			木村(由)(Kimura, Tohmyoh Lab)	6898
DC対向ターゲットスパッタ (Facing target DC sputter)	戸田 (Toda, Ono Lab)	5810				
RF対向ターゲットスパッタ (Facing target RF sputter)	田中(秀) (Tanaka, S.Tanaka Lab)	6937				
EB蒸着 (EB evaporation)	Wang J. (S.Tanaka Lab)	6937				
RF magnetron sputter #1 (Shibaura)	小松(Komatu, Shimizu Lab)	6925	【研究室内担当】 田中(秀)：Kondo 小野： Kao 金森：Liu		渡辺(Watanabe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab)	6256 4894
RF magnetron sputter #2 (Shibaura)	Kao (Ono Lab), Rahul (Ono Lab)	5810	【研究室内担当】 田中(秀)：Kondo 金森：Liu		渡辺(Watanabe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab)	6256 4894

ECR plasma sputter					S. Tanaka Lab	6937
Wafer bonder (先端融合Technofine)					S. Tanaka Lab	6937
ECR ion beam sputter	KHUE (Ono Lab.)				Ono Lab	5810
High-temp RF magnetron sputter	猪股 (Inomata, Kanamori Lab)	4894				
Multi-target sputter(Anelva)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	Vergara(S.Tanaka Lab)	6937	S. Tanaka Lab.	6937
イエロールーム Yellow room (1F clean room)						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
レーザー描画装置#1 (Laser lithography system #1)	小山（Koyama, T.Tanaka Lab) 坂本(Sakamoto, T.Tanaka Lab)	6909	申（Shen, Fukushima Lab)	5248	T.Tanaka Lab	6909
EVG mask aligner					S.Tanaka Lab	6937
EVG接合用基板洗浄 (EVG megasonic cleaner)	小川(Ogawa, S.Tanaka Lab)	6937			S. Tanaka Lab	6937
EVGプラズマ表面活性化装置 (EVG plasma activator)	小川(Ogawa, S.Tanaka Lab)	6937			S. Tanaka Lab	6937
二流体洗浄装置 (Two-fluid cleaner)	宇川(Ukawa, S.Tanaka Lab)	6937	山下(Yamashita, S.Tanaka Lab)	6937	門田(Kadota, S.Tanaka Lab)	6937
HMDS処理装置 (HDMS treatment system)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
マスクアライナーSUSS#1(Mask aligner SUSS#1)	堂守(Doumori, MNC)	6256				
マスクアライナーSUSS#2 (Mask aligner SUSS#2)	堂守(Doumori, MNC)	6256				
スピンコーター(Spin coater)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
Spray coater(SUSS)	市坪(Ichitsubo, Fukushima Lab)	022-398-6264	坂本（Sakamoto, T.Tanaka Lab)	6909	Fukushima Lab	5248
マスクアライナーSUSS#3 (Mask aligner SUSS#3)	遠藤 (Endo, Fukushima Lab)	022-398-6264	小山（Koyama, T.Tanaka Lab)	6909	Fukushima Lab	5248
暗室 Dark room (1F clean room)						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
EB描画装置(Electron beam lithography、JEOL-EB)	Guo (S.Tanaka Lab)	6937			Guo (S.Tanaka Lab)	6937
Scanning acoustic microscope (KSI)	森 (Mori, Fukushima Lab)	4119	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	Fukushima Lab	5248
Contact angle meter(Kyowa)	森 (Mori, Fukushima Lab)	4119	張（Zhang, T.Tanaka Lab)	6909	Fukushima Lab	5248
レーザー加工室 Laser fab. Room 2F						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
YAGレーザー (YAG laser)	西野 (Nishino, Ono Lab)	5810	加藤 (Kato, Ono Lab)	5810		
ホール効果測定装置 (Hall effect measure)					Kanamori Lab	4894
PLD	Tang(S.Tanaka Lab)	6937			Vergara(S.Tanaka Lab)	6937
VIM/冷却CCDカメラ(VIM/cooled CCD camera)					戸田(Ono lab)	5810
分析室 Analysis room 2F						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
高分解能SEM(High resolution SEM,日立)	渡辺(MNC)[Watanabe(MNC)]	6256				
FIB	菅野(Kanno, Tohmyo Lab)	6898			木村(由)(Kimura, Tohmyoh Lab)	6898
日立イオンスパッタコータ	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
TG/DTA装置(TG/DTA)						
断面試料作製ミリング装置 (Ion milling SEM sample maker)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				
断面試料作製研磨装置 (Polishing SEM sample maker)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				
高周波レーザードップラー振動計(High-frequency laser doppler vibrometer)	Vergara (S.Tanaka Lab)	6937				
紫外可視近赤外分光光度計 (UV/Vis./IR spectrometer)	神永 (Kaminaga, Matsumoto Lab)	7267				
薄膜評価装置 (Thin film characterization system)					渡辺(Watanabe, MNC) 堂守(Doumori, MNC)	6256
全真空顕微FTIR (FT-IR)	大橋 (Ohashi, Ono Lab)	5810	太田(Ota, S.Tanaka Lab)	6937		
マイクロシステムアナライザMSA-500,400 (Microsystem analyzer MSA-500,400)	山並 (Yamanami, Ono Lab)	5810	【研究室内担当】 PSV: Fang (S. Tanaka Lab), TMS:Tang (S. Tanaka Lab) PMA：Toda, (Ono Lab)		戸田(Toda, Ono Lab)	5810
紫外分光エリプソメーター (Ultraviolet spectroscopic ellipsometer)	相原 (Kanamori Lab)	4894			Kanamori lab	4894
光学測定室 Optical meas. Room 2F						
装置名 Equipment	**主担当者 1st Responsible person**	**内線Ext**	**副担当者 2nd resonsible person**	**内線 Ext**	**問合せ先/Contact**	**内線Ext**
XeF2ガス等方性Siエッチャー (XeF2 gas Isotropic Si etcher)					S. Tanaka lab	6937
プラズマダイヤモンドCVD (Plasma diamond CVD, Astex)	Z. Zhang (Ono Lab)	5810	Toan (Ono Lab)	5810	Ono Lab	5810

赤外線ウェハ接合評価装置 (Wafer bonding inspector)	竹内 (Takeuchi, Higurashi Lab)	7095	松本(Matsumoto, S.Tanaka Lab)	6937		
圧縮引張試験機 (Tension and compression fatigue tester)					S. Tanaka Lab.	6937
原子層堆積装置(Atomic Layer Deposition)	熊野 (Kumano, S.Tanaka Lab)	6937				
鉛含有複合酸化膜スパッタ装置 (Sputter machine for Pb based complex oxide	Tang (S. Tanaka Lab)	6937				
昇温脱離分析装置(Thermal Decomposition Spectroscopy)	Adachi (S.Tanaka Lab)	6937				
14(8.5)GHzネットワークアナライザー (14GHz network analyzer)	Guo(S.Tanaka Lab)	6937	山下(S. Tanaka Lab)	6937		
三菱赤外線カメラ(Mitsubishi infrared camera)					塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
アビオニクス赤外線カメラ(Avionics infrared camera)	近藤 (Kondo, S.Tanaka Lab)	6937			塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937

組立評価室 Assembly test room 2F

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
電解めっき装置#1 (Electroplating#1)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
電解めっき装置#2 (Electroplating#2)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
レーザードップラー振動計 (Laser doppler vibrometer、ネオアーク)	Wang (S. Tanaka Lab)	6937			Ono Lab	5810
紫外線露光装置 (UV exposure)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
ワイヤボンダ#1 (Wire bonder#1)	近藤(Kondo, S.Tanaka Lab)	6937				
フリップチップボンダ#2 (Flip chip bonder#2)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937				
ダイサー (Dicer)	Minh (Kanamori Lab)	4894	堂守(Doumori, MNC)	6256	Kanamori Lab	4894
卓上コイル巻き器					戸田(Toda, Ono lab)	5810
パリレン蒸着器 (Palylene evaporator)					S.Tanaka Lab	6937

電気実験室 Erectric experiment room 3F

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
基板加工装置 (Circuit board plotter)					塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
旋盤 (Lathe)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
ボール盤 (Drill press)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				
フライス盤 (Milling machine)	坂本(Sakamoto, MNC)	6256				

3階実験室 3F experiment room

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
フリップチップボンダ#1 (Flip chip bonder#1)					清水 (Shimizu, Yugami Lab)	6925
研削装置 (Grinding machine)	Zhu (S.Tanaka Lab)	6937				
レーザダイサー (Laser dicer)	Vergara (S.Tanaka lab)	6937				
接合力評価装置 (Bonding force measurement system)	鈴木(裕)(Y. Suzuki, S.Tanaka Lab)	6937				
ワイヤボンダ#2 (Wire bonder#2)	Zhu (S.Tanaka Lab)	6937			塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937

ナノマシニング棟 Nano machining building (clean room)

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
ESCA分析装置 (XPS)	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248	尾崎(Ozaki, Samukawa)	片平5318	田中(文) (B.Tanaka, Fukushima Lab)	5248
走査型プローブ顕微鏡(Ｏｌｙｍｐｕｓ) (Olympus SPM)	小野(Ono, Ono Lab)	5810				
走査型プローブ顕微鏡(Shimazu) (Shimadzu SPM)	小野(Ono, Ono Lab)	5810				
プラズマCNT-CVD (Plasma CNT-CVD)					Ono Lab	5810
微小振動計測装置(Micro vibration measurement, 2 beams)	富澤 (Tamazawa, Ono Lab)	5810			小野(Ono, Ono Lab)	5810
レーザー描画装置#2 (Laser lithography system #2)	渡辺(Watanabe, MNC)	6256				
UHV-STM&AFM	小野 (Ono, Ono Lab)	5806				
簡易マスク作製装置 (Simple photo-mask maker)					Ono Lab	5810
真空フリップチップボンダー					塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab)	6937
アルバック2インチスパッタ装置(Ulvac 2inch sputter)	進藤 (Shindo, Ono Lab)	5810	加藤 (Kato, Ono Lab)	5810		

量子 Quantum Building

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
全自動多目的X線回折装置 (XRD)	Tang (S.Tanaka Lab)	6937	阿部 (Abe, Watanabe Lab)		Vergara(S.Tanaka lab)	6937

その他 Others

装置名 Equipment	主担当者 1st Responsible person	内線Ext	副担当者 2nd resonsible person	内線 Ext	問合せ先/Contact	内線Ext
配管溶接機(Process pipe welder)	渡辺 (Watanabe, MNC)	6256				

M: Master student, D: Doctor student
As: Asistant professor, Lec: Lecturer, AP: Associate professor, P: Professor